УДК 535.215

# МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРУКТУР ТИПА МЕТАЛЛ–ДИЭЛЕКТРИК–МЕТАЛЛ ДЛЯ ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ТЕРАГЕРЦОВОГО ИЗЛУЧЕНИЯ

© 2021 г. К. Т. Ч. Ву<sup>1,</sup> \*, Г. М. Казарян<sup>1</sup>, В. Л. Саввин<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова", Физический факультет, Москва, Россия

> \**E-mail: kt.vu@physics.msu.ru* Поступила в редакцию 20.07.2020 г. После доработки 28.08.2020 г. Принята к публикации 28.09.2020 г.

Структуры типа металл—диэлектрик—металл являются перспективным кандидатом на роль эффективного выпрямляющего элемента в терагерцовом диапазоне. Рассматривается численная модель подобной структуры, использующая метод конечных элементов в формализме неравновесной функции Грина.

DOI: 10.31857/S0367676521010300

#### **ВВЕДЕНИЕ**

Терагерцевый диапазон является важным объектом исследования в наше время в силу его многочисленных потенциальных применений в медицине, материаловедении, энергетике и других областях. Детектирование излучения в этом диапазоне — сложная задача. Он расположен между микроволновым и инфракрасным диапазоном, методы которых плохо работают для терагерцевых частот. Например, энергия квантов электромагнитного поля, соответствующая этому диапазону, меньше энергии теплового шума при комнатной температуре, что делает применение фотоэлементов неэффективным [1, 2].

В качестве альтернативы были предложения использовать так называемые ректенны [3, 4], т.е. выпрямляющие антенны. Эти устройства представляют собой антенну, соединенную с выпрямляющим элементом. При преобразовании энергии электромагнитной волны в электрический ток эффективность ректенн в микроволновом диапазоне может достигать 70–90% [4, 5]. Их эффективность для более высоких частот является предметом споров. Пессимистичная оценка, полагающая справедливость применения предела Шокли-Квайссера, составляет примерно 30% [6]. Экспериментальные же работы демонстрируют эффективность порядка единиц процентов в лучшем случае. Улучшение этого показателя во многом зависит от нахождения эффективного выпрямляющего элемента.

Большое количество современных исследований предлагают в качестве этого элемента использовать структуры типа металл—диэлектрик металл. Они, по существу, представляют собой диоды, механизмом переноса заряда в которых является квантовое туннелирование. Теоретически, это позволяет им работать на частотах, достигающих среднего инфракрасного диапазона и, согласно некоторым работам, даже оптического [7–9].

Для структур типа металл-диэлектрик-металл, использующих один слой диэлектрика, было показана невозможность одновременного достижения низкого сопротивления и высокой чувствительности [10]. Предполагается, что применение нескольких диэлектрических слоев или использование асимметричной геометрии их расположения может помочь улучшить эти показатели [10–12]. Эти предложения приводят к существенному усложнению структур, делая их аналитическое рассмотрение очень сложным.

Эта работа посвящена построению численной модели структуры типа металл—диэлектрик—металл с использованием метода конечных элементов в формализме неравновесной функции Грина [13–15]. Метод конечных элементов позволяет строить сетки произвольных форм, что может в перспективе облегчить рассмотрение многомерных структур. Формализм неравновесной функции Грина позволяет получить наиболее детальные сведения о характеристиках структур, что мо-

жет оказаться чрезвычайно полезным при их анализе.

# ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И МЕТОДОЛОГИЯ

Постановка задачи начинается с определения области  $\Omega$ , которая состоит из конечной подобласти  $\Omega_D$  и бесконечных подобластей  $\Omega_{\alpha}$ . Область  $\Omega_D$  соответствует пространству, заполненному диэлектриками, т.е. расчетной области. Области  $\Omega_{\alpha}$  соответствуют металлическим проводникам. Для данной энергии *E* функция Грина  $G(\vec{r}, \vec{r}'; E)$  определяется как

$$(E-H)G(\vec{r},\vec{r};E) = \delta(\vec{r}-\vec{r}'), \quad \vec{r},\vec{r}' \in \Omega, \qquad (1)$$

$$H = -\frac{\hbar^2}{2} \nabla \left( \frac{1}{m(\vec{r})} \nabla \right) + V(\vec{r}).$$
 (2)

Здесь H – гамильтониан всей системы,  $m(\vec{r})$  – эффективная масса частицы (электрона в этой задаче),  $V(\vec{r})$  – профиль потенциальной энергии внутри системы,  $\delta(\vec{r})$  – дельта-функция Дирака. Функция Грина полагается равной нулю всюду на границе  $\partial\Omega$  области  $\Omega$  и удовлетворяет условиям излучения Зоммерфельда на бесконечности. Задача (1) может быть переписана в виде

$$\left(E - H^0 - \Sigma\right) G\left(\vec{r}, \vec{r}; E\right) = \delta\left(\vec{r} - \vec{r}'\right), \quad \vec{r}, \vec{r}' \in \Omega_D, \quad (3)$$

где  $H^0$  – гамильтониан расчетной области, а  $\Sigma$  описывает взаимодействие проводников и диэлектрической подобласти. Величина  $\Sigma$  называется собственной энергией [13]. Собственная энергия может также учитывать различные взаимодействия частиц внутри расчетной области, но в баллистическом приближении ими можно пренебречь. В этом случае собственную энергию можно представить как сумму собственных энер-

гий  $\Sigma^{\alpha}$ , соответствующих проводникам.

Для решения этой задачи методом конечных элементов ее удобно представить в матричном виде:

$$G(E) = \left(EI - H^{0}(E) - \sum_{\alpha} \Sigma^{\alpha}(E)\right)^{-1}, \qquad (4)$$

где I – единичная матрица. Явный вид матриц  $H^0$  и  $\Sigma^{\alpha}$  можно получить обычным способом, использующимся в методе конечных элементов, то

есть применяя формулу Грина к слабой форме задачи (4):

$$\int_{\Omega_{D}} (E - V(\vec{r})) G(\vec{r}, \vec{r}; E) \phi(\vec{r}) dr - - \int_{\Omega_{D}} \frac{\hbar^{2}}{2m} (\nabla G(\vec{r}, \vec{r}; E), \nabla \phi(\vec{r})) dr - - \int_{\partial\Omega_{D}} \frac{\hbar^{2}}{2m} (\nabla G(\vec{r}, \vec{r}; E), \vec{n}) \phi(\vec{r}) ds = \phi(\vec{r}'), \vec{r}, \vec{r}' \in \Omega_{D},$$
(5)

где  $\phi(\vec{r})$  — пробная функция,  $\vec{n}$  — внешняя нормаль к границе  $\partial \Omega_D$ . На этом этапе следует выбрать базисные функции и разложить по нему все неизвестные величины.

$$\phi(\vec{r}) = \sum_{p} \phi_{p}(\vec{r}); \quad G(\vec{r}, \vec{r}'; E) =$$

$$= \sum_{k} G_{k}(\vec{r}'; E) \phi_{k}(\vec{r}) = \sum_{k,l} G_{k,l}(E) \phi_{l}(\vec{r}') \phi_{k}(\vec{r}), \quad (6)$$

где  $\phi_p(\vec{r})$  — базисные функции, которые в простейшем случае выбираются кусочно-линейными, а  $G_{k,l}(E)$  — коэффициенты разложения фунцкии Грина по этому базису.

Подставляя эти выражения в (5) можно получить явные выражения для матриц, используемых в (4):

$$H^{0}_{k,l} = \int_{\Omega_{D}} V(\vec{r}) \phi_{k} \phi_{l} dr + \int_{\Omega_{D}} \frac{\hbar^{2}}{2m} \nabla \phi_{k} \nabla \phi_{l} dr;$$
  
$$ES_{k,l} = \int_{\Omega_{D}} E \phi_{k} \phi_{l} dr; \quad \Sigma_{k,l} = \int_{\partial\Omega_{D}} \Sigma(\vec{r}) \phi_{k} \phi_{l} ds;$$
  
(7)

Матрица  $S_{k,l}$  является своеобразным аналогом единичной матрицы в выбранном базисе.

Собственные энергии соответствуют интегралу по границе в выражении (5), но в то же время требуют знания производной по нормали функции Грина. Для ее нахождения в общем случае требуется решить задачу для вспомогательной функции Грина внутри полубесконечных областей, соответствующих проводникам. В одномерном же случае влияние собственных энергий в контексте метода конечных элементов проявляется в виде граничных условий Робена [13]:

$$\int_{\partial\Omega_{D}} \frac{\hbar^{2}}{2m} (\nabla G(\vec{r},\vec{r};E),\vec{n})\phi(\vec{r}) ds =$$

$$= \sum_{\alpha} \int_{\Omega_{D}} -\frac{i\hbar^{2}}{2m_{\alpha}} \sqrt{\frac{2m_{\alpha}(E-V_{\alpha})}{\hbar^{2}}} G(\vec{r},\vec{r};E)\phi(\vec{r}) ds; \quad (8)$$

$$\Sigma_{k,l}^{\alpha} = \int_{\partial\Omega^{\alpha}} -\frac{i\hbar^{2}}{2m_{\alpha}} \sqrt{\frac{2m_{\alpha}(E-V_{\alpha})}{\hbar^{2}}} \phi_{k}\phi_{l} ds,$$

E

где  $\partial \Omega^{\alpha}$  — граница раздела между расчетной областью и проводником,  $m_{\alpha}$  — эффективная масса электрона в проводнике  $\alpha$ ,  $V_{\alpha}$  — значение потенциала в соответствующем проводнике.

Коэффициент прохождения T(E) и электрический ток J через структуру могут быть найдены из выражений

$$T(E) = \operatorname{tr}\left(\Gamma^{1}G\Gamma^{2}G^{+}\right); \quad \Gamma^{\alpha} = -i\left(\Sigma^{\alpha} - \Sigma^{\alpha+}\right);$$
  

$$\alpha = 1, 2, \quad J = \frac{e}{\pi\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} T(E)(f_{FD}(E - \mu_{1}) - (9))$$
  

$$- f_{FD}(E - \mu_{2}))dE,$$

где e – заряд электрона,  $\Gamma^{\alpha}$  – диссипативная функция уширения,  $\mu_{\alpha}$  – химический потенциал соответствующего проводника,  $f_{FD}(E)$  – функция распределения Ферми–Дирака. Верхний индекс + обозначает эрмитово сопряжение. Для удобства можно принять уровень энергии Ферми одного из проводников равным нулю и отсчитывать все энергии от него. Таким образом, выражение для плотности тока можно переписать в виде

$$J = \frac{e}{\pi\hbar} \int_{-\infty}^{\infty} T(E) (f_{FD}(E) - f_{FD}(E - eV_b)) dE, \quad (10)$$

где  $V_b$  — напряжение смещения между проводниками.

Следует отметить, что в силу характера распределения Ферми–Дирака лишь конечный диапазон энергий вносит существенный вклад в выражение (10). Особое внимание следует также уделить пикам коэффициента пропускания T(E), приходящимся на упомянутый диапазон. Эти пики могут быть учтены путем применения адаптивного шага дискретизации по энергии, как в работе [10], или через следующую задачу на собственные значения

$$H^{0}\psi(\vec{r}) = E\psi(\vec{r}), \quad \vec{r} \in \Omega_{D},$$
  

$$\psi(\vec{r}) = 0, \quad \vec{r} \in \partial\Omega_{D}.$$
(11)

Эта задача также может быть решена численно. Профиль потенциального барьера может быть представлен как

$$V(\vec{r}) = V_0(\vec{r}) + U_0(\vec{r}), \quad \vec{r} \in \Omega_D, \tag{12}$$

где  $U_0$  — внешний приложенный потенциал, а  $V_0$  — профиль потенциала в структуре в отсутствие смещения. Потенциал  $V_0$  может быть получен из характеристик материалов, если допустить, что все электроны перемещаются по зонам проводимости (рис. 1).

Рис. 1. Профиль потенциального барьера в структуре типа металл—диэлектрик—металл. Область внутри пунктирных вертикальных линий соответствует диэлектрическому слою.  $E_F$  — уровень энергии Ферми металлов,  $E_{vac}$  — уровень энергии вакуума,  $W_{M_{1,2}}$  работы выхода соответствующих металлов,  $\chi_I$  сродство к электрону для данного диэлектрика,  $V_b$  приложенное напряжение, x — условная координата.

Приложенный потенциал U<sub>0</sub> удовлетворяет уравнению Пуассона

$$\nabla(\varepsilon_0\varepsilon(\vec{r})\nabla(U_0(\vec{r}))) = en(\vec{r}), \quad \vec{r} \in \Omega_D,$$
(13)

где  $n(\vec{r})$  — плотность заряда в структуре,  $\varepsilon_0$  — диэлектрическая постоянная, а  $\varepsilon$  — относительная диэлектрическая проницаемость. В одномерном случае при учете потенциала зарядов-изображений выражение для потенциала приобретает вид [13]:

$$V(x) = V_0(x) + U_0(x) - \frac{e^2}{16\pi\varepsilon_0} \times \left(\frac{1}{\int_0^x \varepsilon(x') dx'} + \frac{1}{\int_x^L \varepsilon(x') dx'}\right),$$
(14)

где *х* – координата внутри области расчета, *L* – длина структуры.

Если зарядов внутри структуры нет, задача – одномерна, а диэлектрическая проницаемость имеет кусочно-постоянный характер, то выражение для потенциала можно получить аналитически. В этой работе для сохранения общности подхода задача для потенциала решалась численно, методом конечных элементов.

ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ФИЗИЧЕСКАЯ том 85 № 1 2021



**Рис. 2.** Зависимость метрики ошибки er(N) от числа узлов в сетке пространственного разбиения N для тестовых задач: прямоугольный потенциальный барьер (крестики), барьер-ступенька (кружки).



**Рис. 3.** Полученные зависимости плотности тока *J* от приложенного напряжения  $U_0$  для структур металл-диэлектрикметалл с учетом потенциала зарядов изображений. Сплошная линия – структура W–Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (1 нм)–Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>–(1 нм)–W, пунктирная – W–Nb<sub>2</sub>O<sub>5</sub> (3 нм)–Ta<sub>2</sub>O<sub>5</sub>–(1 нм)–W.

Расчеты производились с использованием вычислительной платформы FEniCS. С ее помощью решалась задача для потенциала и получались матричные выражения для нахождения функции Грина. Описание компонентов платформы можно найти в [16–21].

## РЕЗУЛЬТАТЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ

Модель была протестирована на двух задачах, имеющих хорошо известное решение: задача о туннелировании через прямоугольный потенциальный барьер и задача о туннелировании через барьер-ступеньку. Полученный при моделировании коэффициент прохождения сравнивался с точными выражениями при одних и тех же значениях энергии. Для оценки ошибки вычислений используется следующая формула [22]:

$$er(N) = \max_{E} |T(E) - T_0(E)|,$$
 (15)

где N — число узлов в сетке, T(E) — полученный при моделировании коэффициент прохождения,  $T_0(E)$  — точное выражение для коэффициента прохождения для данного барьера, а значение энергии E ограничено величинами, использован-



**Рис. 4.** Абсолютная величина распределения электрического тока |J(E)| по энергии *E* для резонансной структуры при фиксированном напряжении смещения 0.5 В. Вертикальные пунктирные линии отмечают собственные значения гамильтониана расчетной области  $H^0$ .

ными при моделировании. Результаты представлены на рис. 2.

Также было проведено сравнение между результатами, полученными от данной модели, и данными работы [12] для структур  $W-Nb_2O_5$  (1 нм)– $Ta_2O_5-$ (1 нм)–W и  $W-Nb_2O_5$  (3 нм)– $Ta_2O_5$  (1 нм)–W. Последняя структура характеризуется как резонансная. Полученные для этих структур вольт-амперные характеристики представлены на рис. 3. Они хорошо согласуются с известными данными.

Можно также показать, что пики зависимости коэффициента пропускания и плотности тока от энергии для резонансной структуры соответствует собственным значениям задачи (11), как видно на рис. 4.

#### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе была представлена одномерная модель переноса заряда посредством квантового туннелирования в структурах типа металл—диэлектрик—металл, использующая метод конечных элементов и формализм неравновесной функции Грина. Модель была проверена на тестовых задачах. Полученные при моделировании результаты хорошо соответствуют известным для этих задач решениям.

Замечено, что задача на собственные значения, связанная с профилем потенциального барьера, может дать приблизительные энергии пиков зависимости коэффициента пропускания от энергии электронов. Эта информация может помочь сделать расчеты более точными и производительными, например, путем сокращения количества разбиений диапазона энергий, для которого производятся вычисления. Модель также может быть расширена на большее число пространственных измерений без существенных изменений в постановке задачи. Как показано в работе [13], собственные энергии металлических контактов могут быть выражены через собственные функции подводящих проводов, например, представляя их в виде полубесконечных полос. При этом вычислительная сложность должна резко вырасти, поскольку такой характер имеют часто используемые в данной модели матричные операции. Правильная дискретизация диапазона энергии, используемого в расчете, может помочь сохранить точность и замедлить рост требуемых вычислительных ресурсов.

### СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. *Shank J., Kadlec E.A., Jarecki R.L. et al.* // Phys. Rev. Appl. 2018. V. 9. Art. No 054040.
- 2. *Zhu Z., Joshi S., Moddel G. //* IEEE J. Sel. Top. Quant. 2014. V. 20. Art. No 3801409.
- 3. Bailey R. // J. Eng. Power. 1972. V. 94. P. 73.
- 4. *Shinohara N.* // IEICE Electron. Expr. 2013. V. 10. Art. No 20132009.
- Douyère A., Lan Sun Luk J.D., Alicalapa F. // Electron. Lett. 2008. V. 44. P. 1409.
- Joshi S., Moddel G. // J. Phys. D. 2016. V. 49. Art. No 265602.
- Mitrovic I.Z., Weerakkody A.D., Sedghi N. et al. // Appl. Phys. Lett. 2018. V. 112. Art. No 012902.
- Hartman T.E. // J. Appl. Phys. 1962. V. 33. Art. No 3427.
- 9. *Moddel G., Grover S.* Rectenna solar cells. N.Y.: Springer, 2013.
- Shin J.H., Yang J.H., Heo S.J., Jang J.E. // AIP Adv. 2017. V. 7. Art. No 105307.
- 11. Grover S., Moddel G. // Sol. St. Electron. 2012. V. 67. P. 94.

- 12. *Jiang H., Shao S., Cai W., Zhang P.* // J. Comput. Phys. 2008. V. 227. P. 6553.
- Havu P., Havu V., Puska M.J., Nieminen R.M. // Phys. Rev. B. 2004. V. 69. Art. No 115325.
- 14. *Polizzi E., Datta S.* // Proc. Third IEEE Conf. Nanotechnol (San Francisco, 2003). V. 2. P. 40.
- 15. *Alnaes M.S., Blechta J., Hake J. et al.* // Arch. Numer. Software. 2015. V. 3. Art. No 20553.
- 16. Logg A., Mardal K.-A., Wells G.N. et al. Automated solution of differential equations by the finite element method. Springer, 2012.
- *Kirby R.C., Logg A.* // ACM Transact. Math. Software. 2011. V. 32. No 3. P. 417.
- Alnaes M.S., Logg A., Olgaard K. et al. // ACM Transact. Math. Software. 2014. V. 40. P. 1.
- Kirby R.C. // ACM Transact. Math. Software. 2004. V. 30. P. 502.
- 20. Alnaes M.S., Logg A., Mardal K.-A. et al. // Inter. J. Comp. Sci. Engin. 2009. V. 4. No 4. P. 231.
- 21. *Abdolkader T.M., Shaker A., Alahmadi A.N.M.* // Eur. J. Phys. 2018. V. 39. No 4. Art. No 045402.

# Metal-insulator-metal structures modelling for terahertz radiation detection

K. T. C. Vu<sup>a, \*</sup>, G. M. Kazaryan<sup>a</sup>, V. L. Savvin<sup>a</sup>

<sup>a</sup>Lomonosov Moscow State University, Faculty of Physic, Moscow, 119991 Russia \*E-mail: kt.vu@physics.msu.ru

Received July 20, 2020; revised August 28, 2020; accepted September 28, 2020

Metal-insulator-metal structures are considered to be a promising candidate for rectifying elements in terahertz rectennas. This study considers a numerical model of such a structure that implements finite-element method in non-equilibrium Green's function formalism.